

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 2 年 1 月 23 日 (2020.1.23)

【公開番号】特開 2019-207923 (P2019-207923A)

【公開日】令和 1 年 12 月 5 日 (2019.12.5)

【年通号数】公開・登録公報 2019-049

【出願番号】特願 2018-101949 (P2018-101949)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

C 3 0 B 29/06 (2006.01)

C 3 0 B 33/00 (2006.01)

C 1 1 D 7/18 (2006.01)

C 1 1 D 7/54 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/304 6 4 8 G

C 3 0 B 29/06 B

C 3 0 B 33/00

C 1 1 D 7/18

C 1 1 D 7/54

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 11 月 27 日 (2019.11.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シリコンウェーハを S C 1 洗浄した後、酸化力を有する洗浄液で洗浄するシリコンウェーハの洗浄方法であって、

前記 S C 1 洗浄により前記シリコンウェーハの表面に形成されたケミカル酸化膜を、前記酸化力を有する洗浄液で洗浄することにより、更に前記ケミカル酸化膜の厚さが 1 . 0 n m 以上になるように成長させ、

前記 S C 1 洗浄した後、前記酸化力を有する洗浄液で洗浄するより前に、 S C 2 洗浄し

、

前記 S C 1 洗浄するシリコンウェーハを D H F 洗浄していないシリコンウェーハとすることを特徴とするシリコンウェーハの洗浄方法。

【請求項 2】

前記酸化力を有する洗浄液として、オゾン水及び / 又は過酸化水素水を用いることを特徴とする請求項 1 に記載のシリコンウェーハの洗浄方法。